



光設計研究グループ 第40回研究会

「半導体露光技術の現状と展望」

【日時】2008年12月11日(木) 10:30~17:00

【場所】電気通信大学 マルチメディアホール(総合研究棟3F)

東京都調布市調布ヶ丘1-5-1

・京王線 調布駅下車 北口より徒歩5分

交通の詳細はこちらを参照 → <http://www.uec.ac.jp/map/comm.html>

プログラム

10:30	開会の挨拶		
10:40	1. 露光光学系関連技術オーバービュー	○今井 基勝 氏	(ニコン)
11:20	2. 32nm以降に向けた半導体 リソグラフィーの技術動向	○宮崎 順二 氏	(ASML Japan)
12:00	昼食		
13:10	3. キヤノンにおけるEUV露光装置の開発	○長谷川 隆行 氏	(キヤノン)
13:50	4. 半導体露光装置光学系の特徴	○渋谷 真人 氏	(東京工芸大)
14:30	5. EUVリソグラフィ技術の現状と課題	○田中 雄介 氏	(Selete)
15:10	休憩		
15:30	6. オプティカルリソグラフィにおける 超解像法2D-TCC	○八講 学 氏	(キヤノン)
16:10	7. Field-Zernike関数を用いた収差の推定	○氏家 知子 氏	(ニコン)
16:50	閉会の挨拶		
17:30	懇親会		

一部の講演題目は、仮題になっています

【主催】日本光学会(応用物理学会)光設計研究グループ(代表:榎田 博文(オリンパス))

【参加費】光設計研究グループ会員:4,000円、光設計研究グループ学生会員:無料

一般:10,000円、学生一般:2,000円。当日、受付にてお支払い下さい。

【定員】80名(定員になり次第締め切ります。定員オーバー後の申込みはその旨ご連絡致します。)

【参加申込】下記申込書の内容をE-mail またはFAXまたは郵送にて下記申込先にお送り下さい。

【申込先】オリンパス(株) 研究開発センター 光学技術部 技術1グループ 足立 要人

〒192-8512 東京都八王子市久保山町2-3

TEL: 042-691-7176, FAX: 042-691-7573

E-mail: S40reg@opticsdesign.gr.jp

【問合せ先】キヤノン(株) オプティクス技術開発センター オプティクス21開発室 森島 英樹

〒321-3298 栃木県宇都宮市清原工業団地23-10

TEL: 028-667-5711, FAX: 028-667-9602

E-mail: S40@opticsdesign.gr.jp

【ホームページ】<http://www.opticsdesign.gr.jp/>

オリンパス(株) 研究開発センター 光学技術部 技術1グループ 足立 要人 行

光設計研究グループ 第40回研究会 申込書

氏名(フリガナ)	
所属	
住所 TEL、FAX E-mail	
参加区分(○印)	1. 光設計研究グループ会員、2. 学生会員、3. 一般、4. 学生一般
懇親会(○印)	1. 参加、 2. 不参加 (懇親会は参加無料です)
アンケート(一般・学生一般) 本研究会をどこで知りましたか?	1. WEB 2. メール 3. ビラ 4. 雑誌() 5. 会社・学校 6. その他()